

高性能デスクトップマスクアライナー

LA310k

新製品

高精度DeepUV光源搭載！
コンパクトな微細露光のスタンダード機

DeepUV光源マスクアライナー

本装置は、半導体素子デバイス等フォトリソグラフィーを必要とする研究分野において、微細度の高いパターン露光ができる露光装置です。波長選択フィルターを複数枚内蔵可能な高性能インテグレートレンズ方式のDeepUV光源装置を搭載し、波長域 $\lambda=254\sim 500\text{nm}$ の遠紫外域の照射を実現しています。

また同軸落射照明付きの1~6.3×ズーム式実体顕微鏡は接眼/対物レンズの組合せで7.5~425×の広倍率範囲となります。シンプルな構成でカスタマイズ性にも優れています。



(改良のため仕様・意匠は変更されることがあります)

主な仕様

- ◆露光方式 ▪ 1:1(等倍)コンタクト露光
- ◆適応試料 ▪ サイズ 最大 ϕ 4インチ ▪ (露光エリアはUV光源によって決まります) 厚さ 最大2mm ▪ 試料台の交換により各種サイズ・形状(角形試料など)に対応します。
- ◆適応マスク ▪ サイズ 最大 \square 5インチ 厚さ 0.06インチまたは0.09インチ
- ◆ランプハウス ▪ 光学形式 インテグレートレンズ、ダイクロイック楕円ミラー方式(レンズ材料は全て石英製) ▪ 使用ランプ 水銀キセノンランプ 200W 照射距離 約80mm ▪ 有効露光範囲 \square 30mm 波長域 $\lambda=254\sim 500\text{nm}$ 放射強度 約 $80\text{mW}/\text{cm}^2$ 以上(at 365nm) ▪ 照度均一度 $\pm 5\%$ 以下 露光量設定 タイマー式(積算光量計制御はオプション) ▪ 複数枚のフィルターを内蔵し外部から切り替えて使用できます。(各フィルターはオプション)
- ◆顕微鏡 ▪ ズーム式実体顕微鏡 ニコン製 SMZ800 接眼レンズ C-W20×(2個) 対物倍率 Plan 1× ▪ フォーカスマウント C-FMC 同軸落射照明装置 P-ICI2 UVカットフィルター(Y44) ▪ 総合倍率 30~189× レンズ組合せは変更できます。(双眼双対物2視野顕微鏡はオプション)
- ◆アライメント方式 ▪ 顕微鏡による目視アライメント(マスク位置固定・試料移動型アライメント)
- ◆アライメントステージ ▪ XYZ軸 微粗動ハンドル操作、 θ 軸 微動ハンドル操作 ▪ Z軸コンタクト・ギャップ微調整 レバー操作 $\pm 125\mu\text{m}$ (エアコンタクト機構はオプション) ▪ レベル(水平)調整 球面摺動機構 真空ロック可能
- ◆マスク架台 ▪ ヒンジ開閉式
- ◆観察位置ステージ ▪ XY軸ストローク $\pm 20\text{mm}$ 手動レバー方式(観察位置ステージはオプションです)
- ◆寸法/重量 ▪ 670(H)×460(W)×540(D)mm以内/80Kg 以下
- ◆ユーティリティ ▪ 電源 ▪ AC100V 10A 以下(UV光源装置込み) ▪ 真空 ▪ 600mmHg以上 ▪ (オプションのエアコンタクト機構使用時はドライエアまたは窒素 $5\text{Kg}/\text{cm}^2$ 程度も必要となります)



株式会社 ナノテック
Nanometric Technology Inc.

www.nanotech-inc.co.jp info@nanotech-inc.co.jp

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-5-8-201 電話 03(3960)3171 Fax 03(3960)3174